

EVG unveils new micro- and nano-imprint solutions to enhance wafer-level optical component mass production capabilities – January 19, 2022

EVG 全新微米及奈米壓印解決方案亮相，強化晶圓級光學元件量產能力

作者 [侯冠州](#) | 發布日期 2022 年 01 月 20 日 8:25 | 分類 [晶圓](#), [晶片](#), [材料](#)、[設備](#)



半導體晶圓設備供應商 EV Group (EVG) 宣布，推出新一代奈米壓印與晶圓級光學系統 EVG 7300，可在單一平台上結合如奈米壓印微影技術 (NIL)、透鏡壓鑄與透鏡堆疊 (UV 接合) 等多重基於 UV 架構的製程；並支援大至 300 毫米的晶圓尺寸，並具備高精度對準功能、先進製程控制與高製程產出量，滿足各種自由形式及高精

度奈米和微型光學元件與設備的量產需求，如晶圓級光學 (WLO)、光學感測器與投影機、汽車照明等。

據悉，EVG7300 做為 UV 奈米壓印微影 (UV-NIL) 的全整合解決方案，其中還可增加如清洗、光阻塗層，以及烘烤或後處理等額外的預處理步驟，以最佳化特定製程的需求。

這套系統透過結合對準階段的改善、高精度光學元件、多點間隙控制、非接觸式間隙量測與多點力控制，具最高可達 300 奈米的對準精度。同時，該系統還提供三種不同的製程模式，包含透鏡壓鑄、透鏡堆疊與 SmartNIL 奈米壓印，並支援 150 毫米到 300 毫米晶圓的基板尺寸；且模板與晶圓的快速裝載、快速對準的光學元件、高功率固化以及極小的工具占用空間，使這套高效平台能夠滿足業界對嶄新 WLO 產品的製造需求。

EV Group 企業技術總監 Thomas Glinsner 表示，最新推出的奈米壓印解決方案，將 SmartNIL 全域壓印技術及透鏡壓鑄和透鏡堆疊結合成一套的系統，具備更精確的對準與製程參數控制，為產業研究與生產需求提供更多彈性。

(首圖來源：EVG)